

半導体 LSI のウエハ洗浄装置の 新開発で業績向上

課題 半導体LSI業界でさらなる 成長を目指したい

半導体 LSI は家電製品、自動車、医療器具等々の小型化・高機能化にともない日進月歩の技術革新が必要な業界だ。株式会社 ECP は創業以来一貫して半導体 LSI のウエハ（半導体製造の材料）洗浄装置の開発・生産（販売）・保守を主たる事業としてきた。リーマンショックによる消費低迷の煽りで半導体業界が苦境を強いられた時もあったが、平成 25 年以降のスマートフォン向け LSI の需要増の波に乗り、苦境を乗り越えてきた。同社は半導体 LSI 業界では古参であり、ウエハ製造工程における洗浄の技術提案には業界内でも定評があり、業界内での認知度の高さは同社の強みである。近年はスマートフォン向け需要も一巡し、さらなる成長に向けて IoT 向けの対応を見据えていた。

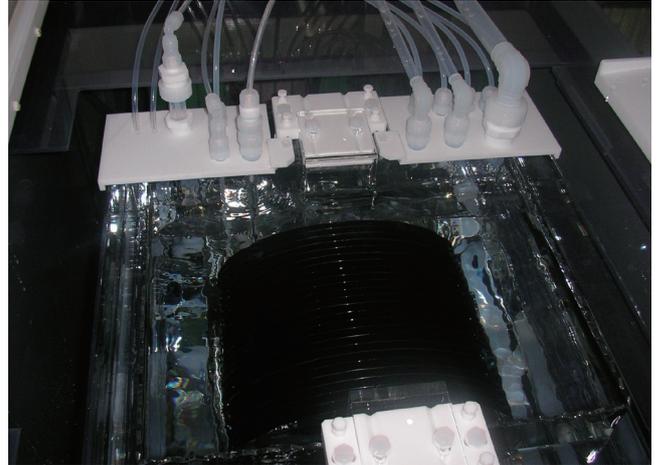
しかし、IoT 向け対応の洗浄ニーズはまだ明確ではないため、半導体デバイス製造事業者向けの洗浄装置の開発と保守にも市場を開拓することになった。これまでの半導体ウエハ製造事業者向けのほかに、新たに半導体デバイス製造事業者向けの洗浄装置の開発・生産（販売）と保守にも参入することで経営の安定と向上を図りたいと考えた経営者は、新たな設備導入のための資金調達について、藤野商工会に相談に訪れた。

支援 支援で業績拡大と 事業承継を実現

商工会では、神奈川県小規模企業支援強化事業を活用し、専門家（中小企業診断士）とともに経営革新事業のテーマの検討と設定、課題抽出を行った。さらに、そのヒアリング内容のもとで決算書を分析し、経営革新計画の目標、実施計画、資金計画の骨子作成など、新事業による販売拡大を図ることとした経営革新計画書の作成を支援。平成 30 年 2 月に経営革新計画の承認を受けることができた。

また、商工会は同社が国内メーカーと共同で開発し製品化した半導体 300mm ウエハ基盤容器の洗浄装置の販路開拓・拡大支援も行った。平成 29 年度には国内をはじめ、台湾、韓国、東南アジア方面の営業展開をさらに強化させたことで、直近期の売り上げ・利益を大幅に伸ばす結果となった。

経営革新計画書の作成やものづくり補助金の申請支援時に



ウエハ洗浄装置

は、現在は営業部門・技術部門で中心的なポジションにいる経営者の長男にも同席を依頼。事業承継を見据えた計画を作成し、将来の事業承継に向けた支援も行った。

ものづくり補助金の申請結果は不採択だったが、経営革新計画 1 年目の売り上げ目標（11 億 1500 万円）はすでに達成している。新製品においても主要なデバイス製造事業者からの引き合いをすでに受けており、今回の支援で、ウエハ、デバイス両方の事業へ進出し、販売先の多様化を実現できたことは大きな成果だ。今後もさらなる業績の向上が期待される。

支援の経過

期間	支援内容
H29年5月～	専門家派遣、職員によるヒアリング開始・経営革新計画の申請支援
H30年2月	経営革新計画の承認
4月～	専門家派遣、職員によるものづくり補助金の申請支援

会社概要

会社名：株式会社ECP
 住所：神奈川県相模原市緑区日連1512
 電話番号：042-687-3846
 URL：http://www.eqclpr.com
 代表者名：代表取締役 佐々木道他
 創業年：昭和52年
 年間売上高：12億1595万円(平成30年)
 従業員数：15名
 商工会名・担当者名：藤野商工会・丹羽大祐